Layout-Corrector: Alleviating Layout Sticking Phenomenon in Discrete Diffusion Model

岩井 翔真^{1,a)} 長内 淳樹^{2,b)} 北田 俊輔^{2,c)} 大町 真一郎^{1,d)}

概要

レイアウト生成は、カテゴリ・位置・サイズで記述され る要素の集合を生成するタスクである.人間が試行錯誤を 通じてレイアウトを洗練させるのに対し、現在主流の離 散拡散モデル (DDM) では一度生成された要素が固着し、 修正されないことを示す.この課題に対して、本研究では 不調和な要素を検出する Layout-Corrector (LC) を提案す る.LC は DDM の生成結果を評価し、評価値の低い要素を 初期化することで要素の固着を防ぐ.実験の結果、様々な DDM に対して提案手法は一貫した性能改善を達成した.

1. はじめに

レイアウト生成はカテゴリ,位置,サイズで表現される 要素の集合を生成するタスクであり,UI,広告等のデザイ ン自動化に向けて重要な技術である [15,18]. このタスク では深層学習ベースの手法が高い性能を示しており、現在 は離散拡散モデル (DDM) [5,9,21] を用いた手法が最先端 (SoTA)である.調和のとれたレイアウトは試行錯誤を通 じて作成されるが、3.2節で示す通り、現在の DDM では、 一度生成された要素が以降更新されずに固着することがわ かった(図1上).この修正能力の欠如に対処するため、不 調和な要素を検出する Layout-Corrector (LC) を提案する (図1下). LC は DDM の生成過程で暫定の生成レイアウ トを評価し、不調和な要素を初期化する. 初期化された要 素を DDM で再生成することで,レイアウトの修正機能を 実現する.実験では、LCは複数のDDMに対して性能改 善を達成した.また、生成の多様性と忠実性の制御や、生 成ステップ数を減らした際の性能低下の抑制に成功した.

2. 関連研究

初期のレイアウト生成の研究では、要素のアライメント

- ^{a)} shoma.iwai.s4@dc.tohoku.ac.jp
- ^{b)} atsuki.osanai@lycorp.co.jp

 $^{\rm d)}~$ shinichiro.omachi.b5@tohoku.ac.jp



図 1: Layout-Corrector の概略.

など幾何的な制約を最小化する最適化ベースの手法が提案 された [16,17]. その後, GAN [14,23] や VAE [10,20] と いった深層学習ベースの生成モデルがレイアウトの分野で も発展した.また,画像処理,自然言語処理での成功を受 け,レイアウト生成においても Transformer ベースの手法 が多く提案されている [1,6,11].近年では拡散モデルを用 いた手法が SoTA を達成しており,レイアウト生成分野の 研究の主流となっている [8,9,21].特に非自己回帰 (NAR) の生成手法や拡散モデルによる手法は,条件なしの生成に 加え,ユーザーが与える制約による条件付き生成の両者に 対応できるため,その汎用性から研究が盛んである.

3. 提案手法

3.1 離散拡散モデル

N 要素からなるレイアウトを $l_i = (c_i, x_i, y_i, w_i, h_i), i \in [1, N]$ と表現する.ここで, c, (x, y), (w, h) はカテゴリ, 中心座標, サイズを表す.(x, y, w, h) は連続量であるため, [0, 1] に正規化後に bin 数 *B* で離散化する.すなわち, $c_i \in \{1, \dots, C\}, (x_i, y_i, w_i, h_i) \in \{1, \dots, B\}^4$ となる.

次に DDM について説明する. DDM の学習は,トー クン列を崩壊する拡散過程,崩壊されたトークン列を復 元する生成過程からなる.時刻 t であるトークンがとる 値を $z_t \in \{1, \dots, K\}$ とする. 先行研究 [9] に従い,任 意長の要素を表現するための [PAD],拡散過程の最終状

¹ 東北大学大学院工学研究科 通信工学専攻

² LINE ヤフー株式会社

^{c)} s.kitada@lycorp.co.jp



(a) 時刻 t に対する $\bar{\beta}_t$ のスケジュール (上図), および tokensticking-rate (TSR) (下図).



(b) $\bar{\beta}_t$ スケジュールに対する, Token-replace, および Maskreplace でのランダムに置換されたトークンの修正成功率.



態を表す [MASK] を導入し,合計 (K + 2) 個の状態を扱 う. 拡散過程は遷移行列 $\mathbf{Q}_t \in [0,1]^{(K+2)\times(K+2)}$ を用いて, $q(z_t|z_{t-1}) = \mathbf{v}(z_t)^{\mathsf{T}} \mathbf{Q}_t \mathbf{v}(z_{t-1})$ と書くことができる. ここ で, $\mathbf{v}(z_t) \in \{0,1\}^{K+2}$ は z_t の one-hot 表現である. また, 累積遷移行列 $\bar{\mathbf{Q}}_t = \mathbf{Q}_t \mathbf{Q}_{t-1} \cdots \mathbf{Q}_1$ を用いることで,時刻 0 から t への遷移を $q(z_t|z_0) = \mathbf{v}(z_t)^{\mathsf{T}} \bar{\mathbf{Q}}_t \mathbf{v}(z_0)$ と書くこと ができる. なお, $\mathbf{Q}_t, \bar{\mathbf{Q}}_t$ の各列の総和は 1 となる. 生成 過程では事後確率 $p_{\theta}(z_{t-1}|z_t)$ を求める. θ は生成モデル のパラメータである. ここで, re-parametrization trick を 用い, t = 0 での予測 $\tilde{p}_{\theta}(\tilde{z}_0|z_t)$ を通じて, $p_{\theta}(z_{t-1}|z_t) \propto$ $\sum_{\tilde{z}_0} q(z_{t-1}|z_t, \tilde{z}_0) \tilde{p}_{\theta}(\tilde{z}_0|z_t)$ のように事後確率を求める. 学習の損失関数は,変分下限 \mathcal{L}_{vlb} に加え, $\tilde{p}_{\theta}(\tilde{z}_0|z_t)$ に対 する Cross-Entropy 損失を用いて次のように定義する.

$$\mathcal{L}_{\text{DDM}} = \mathcal{L}_{\text{vlb}} + \lambda \mathbb{E}_{\substack{\boldsymbol{z}_t \sim q(\boldsymbol{z}_t | \boldsymbol{z}_0) \\ \boldsymbol{z}_0 \sim q(\boldsymbol{z}_0)}} [-\log \tilde{p}_{\theta}(\tilde{\boldsymbol{z}}_0 | \boldsymbol{z}_t)].$$
(1)

3.2 事前実験

遷移行列の設計は DDM の挙動を決める上で重要である. 同じ状態に留まる確率を α_t , [MASK] へ遷移する確率を γ_t , それ以外の状態へ遷移する確率を β_t とすると, $\mathbf{Q}'_t = \alpha_t \mathbb{I} + \beta_t \mathbf{11}^\top \in [0, 1]^{(K+1) \times (K+1)}$ を用いて \mathbf{Q}_t は,

$$\mathbf{Q}_t = \begin{bmatrix} \mathbf{Q}'_t & \mathbf{0} \\ \gamma_t \cdots \gamma_t & 1 \end{bmatrix}, \qquad (2)$$

となる.また, $\bar{\mathbf{Q}}_t$ に対応する各確率を $\bar{\alpha}_t, \bar{\beta}_t, \bar{\gamma}_t$ とする (導出は文献 [5] 参照). LayoutDM [9] では,任意の時刻で $\bar{\beta}_{t,K} = (K+1)\bar{\beta}_t = \epsilon \ (\epsilon \ll 1)$ としている.このとき,図 2a に示す通り,時刻 $t \ge 0$ でのトークン固着率 (TSR) は 100%,つまり一度トークンが [MASK] 以外の状態になると, 以降更新されない.一方, $\bar{\beta}_t > \epsilon$ とすると,TSR < 100% となり固着は緩和される.

次に DDM が持つ不調和な要素の修正能力を確認する. 模擬実験として,真値のレイアウトからランダムに選択し た3トークンを別の状態でランダムに置換し,DDM が真 値を復元できるか評価する.(i) [MASK]以外の状態(Tokenreplace),または(ii) [MASK](Mask-replace)で置換する2 パターンの実験を行い,復元成功率で評価した(図2b). Token-replace の場合, $\bar{\beta}_t = \epsilon$ では固着して修正されない が, $\bar{\beta}_t > \epsilon$ では 10% へと改善する.一方, Mask-replace では特に $\bar{\beta}_t = \epsilon$ のケースで成功率が 35% に到達する.こ の実験により,不調和なトークンを [MASK] に置換するこ とで, DDM がレイアウトを修正できることが示唆された.

3.3 Layout-Corrector

本研究では不調和なトークンを特定するため, Layout-Corrector (LC)を導入する.図3に示すように,LCは DDMの生成過程で各トークンの正しさを評価する.この スコアが低いトークンを [MASK] に置換し,DDMによる 生成を続ける.これにより,LCは生成ミスの修正を明示 的に促す.要素間の関係性を考慮して正しさを判定するた めに,LCにはTransformer [19] ベースの構造を用いた.

次に LC の学習方法 (図 3 上) について述べる. LC は 生成過程で誤生成されたトークンを検出する 2 値分類器 として学習される. 具体的には,真のレイアウト z_0 と時 刻 t に対し,拡散過程を経たトークン列 $q(z_t|z_0)$ を求め, 学習済み DDM を用いて時刻 t-1 の分布 $p_{\theta}(z_{t-1}|z_t)$ を 推定する. この分布からサンプリングを行い, [MASK] を 含まない暫定の生成結果 \hat{z}_{t-1} を得る. LC は \hat{z}_{t-1} と t を 受け取り, \hat{z}_{t-1} と z_0 の各トークンの一致度を示すスコ $P p_{\phi}(\hat{z}_{t-1},t) \in [0,1]^{5N}$ を出力する. 既存研究 [13] では, \hat{z}_{t-1} の各トークンが時刻 t 時点で [MASK] であったかを推 定していたが,我々は z_0 との一致を評価することで,直 接的にレイアウトの正しさを測定する. 学習の損失関数は Binary Cross-Entropy (BCE) 損失,

$$\mathcal{L}_{\text{Corrector}} = \text{BCE}(\boldsymbol{m}, p_{\phi}(\hat{\boldsymbol{z}}_{t-1}, t)), \quad (3)$$

を使用する.ここで $\hat{z}_{t-1}^{(i)} = z_0^{(i)}$ なら $m^{(i)} = 1$, そうでな ければ $m^{(i)} = 0$ とする.

次に、LC と DDM を組み合わせた生成方法について述べ る. 条件無し生成では、図 3 下に示すように、全トークン [MASK] の状態から生成を始める.時刻 t において、DDM が分布 $p_{\theta}(z_{t-1}|z_t)$ を推定し、[MASK] を含まないトークン 列 \hat{z}_{t-1} をサンプリングする.次に LC を使い、各トークン







図 4: 異なる最大遷移幅に対する, (a) 置換しなかったトー クンと, (b) 置換したトークンの平均スコア.

のスコア $p_{\phi}(\hat{z}_{t-1},t)$ を推定する. ランダム性を導入するた めの Gumbel ノイズを加えた後,スコアが閾値 θ_{th} を下回 るトークンを [MASK] に置換する.条件有り生成では,レ イアウトの一部(カテゴリ情報など)が条件として与えら れる.井上ら [9] と同様に,与えられたトークンを初期状 態とし,残りを [MASK] で埋める.生成の各ステップで,条 件として与えられたトークンのスコアを1にすることで, これらが [MASK] で置換されないようにする.

生成時, LC は任意の時刻 t で適用できる.生成時に外部 モジュールを毎時刻適用する既存手法 [13] と異なり,我々 は特定時刻のみで LC を適用する.特に LayoutDM [9] で は,たった3回の適用で性能を大きく改善することがで きる.さらに適用時刻を調整することで,生成の忠実性・ 多様性のトレードオフを制御することができる.具体的に は,頻繁に LC を適用する程,不調和なトークンの初期化 割合が増え,生成の忠実性が向上する.反対に適用回数を 減らすことで多様性が向上する.詳細は 4.3 節で述べる.

4. 実験

4.1 実験設定

実験では、3つの異なるドメインのデータセット (Rico [4], PubLayNet [22], Crello [20]) を使用した. レイアウト生成 のタスクには、条件無しと、要素のカテゴリが条件として 与えられる設定 (C→P+S) を用いる.評価指標には、生成 レイアウトの分布と真の分布の類似度を計測する FID [7] と、生成レイアウトの忠実性と多様性を評価する Precision



図 5: LC の適用時刻を変えた際の FID-Precision の変化.



図 6: 条件無し生成の速度と品質の変化. LC は, 総ステップ数を減らした際の性能低下を抑制できている.



図 7: Rico の生成結果. 青点線部分のように, LC は LayoutDM [9] に見られる不調和な配置を修正できている.

と Recall [12] を用いる.

レイアウト生成のベースラインとして, NAR から MaskGIT [3] を, DDM から LayoutDM [9] を使用する. 生成の総タイムステップ数*T*は, MaskGIT では 10, Lay-

表 1: 条件無し生成における,	提案手法 Corrector (LC) の有無によるベースラインモデルの性能比較.	Arch.	は離散生成
モデルのアーキテクチャを表す	り.ベースラインモデルと比べて改善された評価指標は 太文字 で示す.		

		Rico [4]			Crello [20]			PubLayNet [22]		
Model	Arch.	FID↓	$\operatorname{Precision}\uparrow$	$\operatorname{Recall}\uparrow$	FID↓	$\operatorname{Precision}\uparrow$	$\operatorname{Recall}\uparrow$	FID↓	$\operatorname{Precision}\uparrow$	$\operatorname{Recall}\uparrow$
MaskGIT [3]	Non-AR	70.37	0.793	0.437	35.32	0.802	0.376	34.23	0.587	0.460
MaskGIT + TC [13]		15.65	0.682	0.843	7.59	0.735	0.815	17.55	0.579	0.825
MaskGIT + LC (Ours)		14.40	0.814	0.744	11.17	0.839	0.696	13.74	0.501	0.883
LayoutDM [9]	DDMs	6.37	0.759	0.906	5.28	0.768	0.875	13.72	0.557	0.919
LayoutDM $+$ TC [13]		17.97	0.884	0.670	9.01	0.844	0.678	22.27	0.836	0.582
LayoutDM + LC (Ours)		4.79	0.811	0.891	4.36	0.822	0.851	11.85	0.711	0.890

outDM では 100 とし, LC の適用時刻は, MaskGIT では 毎時刻, LayoutDM では $t = \{10, 20, 30\}$ とする. 閾値 θ_{th} は, MaskGIT では 0.3, LayoutDM では 0.7 に設定した.

4.2 Layout-Corrector の有効性

前述のベースライン手法を例に、Token-Critic (TC) [13] に対する LC の有効性を確認する. TC は画像生成のため に提案された、生成過程の中間状態を評価するモジュール である.表1より,LCはいずれのデータセット,ベースラ インに対しても一貫して FID を改善している.一方,TC は MaskGIT の FID は改善したが、LayoutDM に対しては 悪化させている. これらの結果は, TC を直接レイアウト 生成に適用すると、性能悪化につながることを示している. また、生成の忠実性と多様性については、NAR・DDM で 異なる傾向が見られた. MaskGIT に対して, LC は忠実 性と多様性の両方を改善した. 生成時の確信度を基準とし た MaskGIT の反復的な生成戦略は、忠実性が高く多様性 が低いレイアウトを生み出す. LC はこのようなパターン をリセットするため、忠実性を保ちながら多様性を改善し ている. LayoutDM に対しては、多様性が僅かに低下する ものの、忠実性が改善している. LayoutDM では、拡散モ デルの確率的な挙動で多様性が高まる一方、分布から外れ た状態がサンプリングされる場合もある. LC はこれらを [MASK] に戻して再生成を促し、忠実性を改善している.

4.3 Layout-Corrector の分析

スコアの分析: LC の不調和な要素を検出する能力を確 かめるため, Rico test セットの真のレイアウトのうち, 3 トークンをランダムに置換し, LC のスコアの値を分析し た. 図4は, ランダムにトークンの値を置換する際の最大 遷移幅を変えた時の, 置換されたトークンとそれ以外の トークンの平均スコアを示している. 図より, 置換された トークンのスコアは, それ以外のトークンよりも低くなっ ている. また, 遷移幅を大きくするほど, つまり真のレイ アウトから大きく離れるほど出力スコアが下がる. これら の結果から, LC のスコアは不調和要素の検出だけでなく, 真のレイアウトとの乖離度も表していると言える. スケジュールと忠実性・多様性のトレードオフ: LC を 様々なスケジュールで LayoutDM に適用し, FID (多様性) と Precision (忠実性) への影響を調べた.スケジュールは t = [{10}, {10,20},..., {10,20,...,90}] の合計9パターン 試し,図5の結果が得られた.図より,LCのスケジュー ル変更によって忠実性と多様性のトレードオフを制御でき ることが分かる.適用回数を増やすほど忠実性が上がり, 減らすほど多様性が上がる傾向がある.これは不調和な要 素をリセットするLCの役割と一致しており,多く適用す るほど不調和な要素が減り,忠実性が上がっている. 生成速度と品質のトレードオフ: LayoutDM において生 成時の総タイムステップ数を調整し,LCの有無による生

成時の総タイムステップ数を調整し、LC の有無による生 成品質の変化を調べた.Fast-sampling [2] を用いて総ス テップ数を $T' = \{20, 30, 50, 75, 100\}$ に調整し、それぞれ の実行時間と FID の関係を図 6 に示す.LayoutDM 単体 で生成した場合、T'を減らすと FID が大きく悪化してい るが、LC を用いると FID の低下を抑えることができてお り、T' = 20 でもT' = 100 の LayoutDM と近い性能を達 成している.

4.4 定性評価

Rico データセットにおける条件無し生成と C→S+P 生成の結果を図 7 に示す. LayoutDM + LC では, LayoutDM [9] の時刻 $t = \{10, 20, 30\}$ で LC を適用するため, t = 30 まで LayoutDM と同じ生成過程となる. よって全 体の構成は類似するが, LC の適用により, 要素の重なり や不揃いな配置が修正されている. これは, LC が不調和 な要素を初期化し, 修正を促したことを示している.

5. まとめ

本研究では、DDM における要素の固着を防ぐために Layout-Correctorを提案した. Layout-Corrector は DDM の生成過程で、不調和なトークンを初期化し、DDM に よる修正を促す.実験では、Layout-Corrector は NAR や DDM の手法に対して一貫した性能改善を達成した.また、 生成の忠実性と多様性の制御や、生成ステップ数を減らし た際の性能低下を抑えることに成功した.

参考文献

- [1] Arroyo, D. M., Postels, J. and Tombari, F.: Variational transformer networks for layout generation, *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 13642–13652 (2021).
- [2] Austin, J., Johnson, D. D., Ho, J., Tarlow, D. and Van Den Berg, R.: Structured denoising diffusion models in discrete state-spaces, Advances in Neural Information Processing Systems, Vol. 34, pp. 17981–17993 (2021).
- [3] Chang, H., Zhang, H., Jiang, L., Liu, C. and Freeman, W. T.: Maskgit: Masked generative image transformer, *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 11315–11325 (2022).
- [4] Deka, B., Huang, Z., Franzen, C., Hibschman, J., Afergan, D., Li, Y., Nichols, J. and Kumar, R.: Rico: A mobile app dataset for building data-driven design applications, *Proceedings of the 30th annual ACM symposium on user interface software and technology*, pp. 845–854 (2017).
- [5] Gu, S., Chen, D., Bao, J., Wen, F., Zhang, B., Chen, D., Yuan, L. and Guo, B.: Vector quantized diffusion model for text-to-image synthesis, *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 10696–10706 (2022).
- [6] Gupta, K., Lazarow, J., Achille, A., Davis, L. S., Mahadevan, V. and Shrivastava, A.: Layouttransformer: Layout generation and completion with self-attention, *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, pp. 1004–1014 (2021).
- [7] Heusel, M., Ramsauer, H., Unterthiner, T., Nessler, B. and Hochreiter, S.: Gans trained by a two timescale update rule converge to a local nash equilibrium, *Advances in neural information processing systems*, Vol. 30 (2017).
- [8] Hui, M., Zhang, Z., Zhang, X., Xie, W., Wang, Y. and Lu, Y.: Unifying Layout Generation with a Decoupled Diffusion Model, *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 1942–1951 (2023).
- [9] Inoue, N., Kikuchi, K., Simo-Serra, E., Otani, M. and Yamaguchi, K.: LayoutDM: Discrete Diffusion Model for Controllable Layout Generation, *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 10167–10176 (2023).
- [10] Jyothi, A. A., Durand, T., He, J., Sigal, L. and Mori, G.: Layoutvae: Stochastic scene layout generation from a label set, *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, pp. 9895–9904 (2019).
- [11] Kong, X., Jiang, L., Chang, H., Zhang, H., Hao, Y., Gong, H. and Essa, I.: BLT: bidirectional layout transformer for controllable layout generation, *European Conference on Computer Vision*, pp. 474–490 (2022).
- [12] Kynkäänniemi, T., Karras, T., Laine, S., Lehtinen, J. and Aila, T.: Improved precision and recall metric for assessing generative models, *Advances in Neural Information Processing Systems*, Vol. 32 (2019).
- [13] Lezama, J., Chang, H., Jiang, L. and Essa, I.: Improved masked image generation with token-critic, *European Conference on Computer Vision*, pp. 70–86 (2022).
- [14] Li, J., Yang, J., Hertzmann, A., Zhang, J. and Xu, T.: LayoutGAN: Generating Graphic Layouts with Wireframe Discriminators, *International Conference on Learning Representations* (2019).
- [15] Lok, S. and Feiner, S.: A survey of automated layout

techniques for information presentations, *Proceedings of SmartGraphics*, Vol. 2001, pp. 61–68 (2001).

- [16] O'Donovan, P., Agarwala, A. and Hertzmann, A.: Designscape: Design with interactive layout suggestions, *Proceedings of the 33rd annual ACM conference on human factors in computing systems*, pp. 1221–1224 (2015).
- [17] PeterO' Donovan, Agarwala, A., Hertzmann, A.: Learning layouts for single-pagegraphic designs, *IEEE transactions on visualization and computer* graphics, Vol. 20, No. 8, pp. 1200–1213 (2014).
- [18] Shi, Y., Shang, M. and Qi, Z.: Intelligent layout generation based on deep generative models: A comprehensive survey, *Information Fusion*, p. 101940 (2023).
- [19] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L. and Polosukhin, I.: Attention is all you need, Advances in neural information processing systems, Vol. 30 (2017).
- [20] Yamaguchi, K.: Canvasvae: Learning to generate vector graphic documents, *Proceedings of the IEEE/CVF In*ternational Conference on Computer Vision, pp. 5481– 5489 (2021).
- [21] Zhang, J., Guo, J., Sun, S., Lou, J.-G. and Zhang, D.: LayoutDiffusion: Improving Graphic Layout Generation by Discrete Diffusion Probabilistic Models, *Proceedings* of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, pp. 7226–7236 (2023).
- [22] Zhong, X., Tang, J. and Yepes, A. J.: Publaynet: largest dataset ever for document layout analysis, 2019 International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR), pp. 1015–1022 (2019).
- [23] Zhou, M., Xu, C., Ma, Y., Ge, T., Jiang, Y. and Xu, W.: Composition-aware graphic layout GAN for visualtextual presentation designs, *Proceedings of the Thirty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence*, pp. 4995–5001 (2022).